10　資格の有効期間
　特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。
　ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11　その他
⑴　特定建設工事共同企業体の名称は、「令和８―12年度　山鳥坂ダム洪水吐ゲート設備新設工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
⑵　当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告（建設工事）」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和８年１月16日
国立大学法人山形大学
米沢キャンパス長　黒田　充紀
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　06
○第７号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　26
⑵　購入等件名及び数量
　サステナブルエレクトロニクスプロセス開発装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
　令和８年７月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　サステナブルエレクトロニクスプロセス開発装置は、走査型電子顕微鏡、表面形状測定機、クリーンブース、水蒸気・ガス透過度測定装置、高照度VUV光照射装置、スパッタ／ALD装置、太陽電池寿命評価装置、電池サイクル寿命・特性試験システム、３Dスキャナー、アンテナ放射パターン測定システム、ディスペンサ装置、ボンダー装置それぞれを有すること。
B　走査型電子顕微鏡は、タングステンフィラメントを有し、EDX（EDS）を備え、元素分析が行えること。
C　表面形状測定機は、通常の測定顕微鏡に加え、レーザー顕微鏡を備え３D形状の測定が可能であること。
D　クリーンブース（10式）は、HEPAユニットを搭載（面積３ｘ３m以上）したユニットであること。
E　水蒸気・ガス透過度測定装置は、様々なガス種（水蒸気含む）に対応可能であり、ハイバリア膜の透過度が測定可能であること。
F　高照度VUV光照射装置（ガスバリア膜用と平坦化膜用の２式）は、ハイパワーXeランプを搭載し、サンプルに均一照射が可能であること
G　スパッタ／ALD装置は、スパッタリング装置、原子層堆積（ALD）装置、搬送装置を備え、100mm角もしくはそれ以上のサイズの基板上に、窒化膜や酸化物膜等をスパッタリング法により半自動で形成できること、同サイズの基板上にALD膜を形成できること、両成膜装置間でクリーンに基板を搬送できること。
H　太陽電池寿命評価装置は、１SUN同等の白色光源を有し、16チャンネル以上の太陽電池セル同時測定を可能とした寿命評価装置で、MPPT制御により自動で太陽電池特性の経時変化を測定し評価解析できること。
I　電池サイクル寿命・特性試験システムは、エネルギーデバイス（二次電池など）の電気化学的特性が高精度で測定可能であり、１～数10デバイスの状態を同時にリアルタイムでモニタリングできること。
J　３Dスキャナーは、光学式の測定により物体を測定することで立体形状の測長や読み込みができ、読み取ったデータをCADデータに変換できること。
K　アンテナ放射パターン測定システムは、アンテナパターンの電波放射特性を評価することができ、300MHz～10GHzの特性評価が行えること。
L　ディスペンサ装置は、塗布可能なステージサイズが200mm×200mm以上で、100μm以下の微細なパターン塗布にも対応できること。
M　ボンダー装置は、チップ部品を接着材などでアンテナがパターンされた基材に実装できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和８年２月16日12時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒992―8510　山形県米沢市城南４―３―16　山形大学米沢キャンパス事務部会計課財務会計担当　原　　拓也　電話0238―26―3009
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和８年１月16日から令和８年２月16日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和８年１月23日14時00分
⑵　開催場所　山形大学工学部事務棟１階ミーティングルーム
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the the products to be procured : 26
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Sustainable Electronics Process Development system 1 set
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The Sustainable Electronics Process Development System includes a scanning electron microscope (SEM), a 3D surface profiler, clean booths, a gas and water vapor transmission rate permeation analyzer, a high-intensity VUV light irradiation equipment, a sputtering and atomic layer deposition (ALD) system, a solar cell stability/lifetime testing equipment, a battery charge/discharge test system, a 3D scanner, an antenna radiation pattern measurement system, a dispenser system, and a bonder system, each having their respective capabilities.
B　The scanning electron microscope (SEM) has a tungsten filament and is equipped with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS/EDX) for elemental analysis.
C　The 3D surface profiler includes a conventional optical measurement microscope as well as a laser microscope, enabling 3D shape and profile measurement.
D　The clean booths (10 sets) are equipped with high efficiency particulate air filter (HEPA) units (with an area of 3 m x 3 m or larger for each set).
E　The gas and water vapor transmission rate permeation analyzer can measure the permeability of various gases (including water vapor) and is capable of measuring the gas/water vapor permeability of high-barrier films.
F　The high-intensity VUV light irradiation equipment (two sets for gas barrier films and planarization films respectively) is equipped with a high-power Xe lamp and can provide uniform irradiation to the sample.
G　The sputtering and atomic layer deposition (ALD) system includes a sputtering system, an atomic layer deposition (ALD) system, and a transfer system. It is capable of semi-automatically depositing thin films such as nitrides or oxides on substrates of 100 mm x 100 mm square size or larger using sputtering, as well as forming ALD films on the same size substrates. The device can transfer substrates between the two deposition systems in a clean manner.